525

Cu入りはんだとNiの接合界面分析

(株)村田製作所 〇照喜名 伸泰 山本 宏

坂部 行雄 有吉 昶

# Analysis of the Contact Interface between Solders Containing Cu and Ni

by Nobuyasu Terukina, Hiroshi Yamamoto, Yukio Sakabe and Hisashi Ariyoshi

### <u>1. はじめに</u>

環境保全の立場からはんだの Pb フリー化が進められており、Sn-Ag-Cu 系などの Cu 入り はんだが候補のひとつになっている。受動部品の外部電極にはくわれ防止のために Ni めっ きを施すことが多いが、Cu 入りはんだ中の Cu が Ni 表面に集中し、ボイド発生や強度劣化の 原因となることがわかってきた。はんだ中の特定成分が電極面へ移動する例は他にもいくら か報告されているが、その機構はよくわかっていない。そこで、Cu 入りはんだ中の Cu が Ni 表面に集中する現象について分析調査し、その機構を推定した。

#### 2. 実験方法

Sn-Ag-Bi-Cu、Sn-Cu などの Cu 入りはんだを Ni 板に載せ、250℃で1分間加熱した後放冷した試料について接合界面の分析を行った。また、加熱の各段階での抜き取り分析や接合過程の in-situ 分析を行い、Cu の集中過程を追跡した。

#### 3. 結果と考察

Sn-Ag-Bi-Cu と Ni の界面における EPMA マッピング分析結果を Fig. 1 に示す。Fig. 1 より、 Sn-Ag-Bi-Cu 中の Cu が Ni 表面に集中している様子が認められた。他の Cu 入りはんだ、Sn-Cu や Sn-Pb-Cu についても同様の結果であり、Ni 面への Cu の集中は Cu 入りはんだに共通の 現象であるといえる。



Fig.1 EPMA area analysis at the interface between Sn-Ag-Bi-Cu and Ni

以下、解釈を容易にするため最も単純な Sn-Cu について分析を進めた。Sn-Cu と Ni 界面 の化合物層をエッチングにより露出し、SEM/EDX 分析および XRD 分析した結果を Fig. 2 に示 す。その結果、反応層は針状結晶で、Cu、Ni、Sn から成るものであることがわかった。また、 XRD 分析では化合物層から Cu<sub>6</sub>Sn<sub>5</sub> と Ni<sub>3</sub>Sn<sub>2</sub>の中間的なピークパターンが検出されており、EDX 分析の結果を考え合わせて、Cu は Ni と混じり合い、Sn と 3 元系金属間化合物を生成してい ると解釈できる。

## 溶接学会全国大会講演概要 第61集('97-9)





次に、Cu の集中過程を追跡した。はんだの融解前(融点以下の 220℃まで加熱したもの)、 融解直後、拡がりはじめ、1 分間放置後の各段階での分析結果を Fig.3 に示す。ただし、は んだの融解前では接合強度が微弱であったので、剥離させたはんだ面を EDX で分析した。結 果より、Ni 面への Cu の集中ははんだの融解前から既に始まっており、融解、ぬれ拡がり過 程を経て、進行していくことがわかった。また、はんだ融解前に Ni 側に集中した Cu が Cu<sub>6</sub>Sn<sub>5</sub> であることは別途確認してある。





以上の分析結果より、Ni 面への Cu の集中現象の発 生機構は次のように推定できる。①はんだの融解後、 接合界面に Ni<sub>3</sub>Sn<sub>2</sub> (六方晶)が生成する。②接合界面 近傍の Cu<sub>6</sub>Sn<sub>5</sub> (六方晶)が Ni<sub>3</sub>Sn<sub>2</sub> に取り込まれ、Cu-Ni-Sn 3元系の六方晶として、Cu 集中層を作る。③ Cu<sub>6</sub>Sn<sub>5</sub>が Ni<sub>3</sub>Sn<sub>2</sub> に取り込まれることにより生じた濃度勾配によ り、Cu<sub>6</sub>Sn<sub>5</sub>の移動が進む。④また、Ni と Cu は、ともに 面心立方構造を持ち格子定数がほぼ等しいことも、Cu の Ni 側への移動の推進力として働く。



Fig.4 High temperature X-ray diffraction pattern of the interface between Ni and Sn-Cu